【 支援装置料金表<データ提供**あり**> 】2024年4月1日 改定

北海道大学 ナノテクノロジー連携研究推進室

			北海道大学 ナノテ	//> 座		(m /11)	44-02-1-0	ici (m /s c	44-02-75-7-	ici (m /s.)
設備番号	装置名	メーカー	型式	初回講習料	利用料 学外者(大学·		学外者(大学・	料(円/1h)	学外者(大学・	料(円/1h)
AP-200001	超高精度電子ビーム描画装置 125kV	エリオニクス	FI S-F125-II	35,200	公的機関)	学外者(一般) 8 300	公的機関)	学外者(一般)	公的機関) 12,500	学外者(一般) 17,100
AP-200001 AP-200002	超高精度電子ビーム描画装置 125kV 超高精度電子ビーム描画装置 100kV	エリオニクス エリオニクス	ELS-F125-U ELS-7000HM	35,200 35,200	3,700 2,400	8,300 6,800	8,100 6,800	12,700 11,200	12,500	17,100
AP-200003	マスクアライナ	ミカサ	MA-20	13,200	1,400	2,000	5,800	6,400	10,200	10,800
AP-200004	レーザー描画装置	ネオアーク	DDB-201-200	22,000	900	3,000	5,300	7,400	9,700	11,800
AP-200005	真空蒸着装置	サンバック	ED-1500R	22,000	1,400	2,000	5,800	6,400	10,200	10,800
AP-200006	プラズマCVD装置	サムコ	PD-220ESN	22,000	1,700	4,500	6,100	8,900	10,500	13,300
AP-200007	液体ソースプラズマCVD装置	サムコ	PD-10C1	22,000	600	800	5,000	5,200	9,400	9,600
AP-200008	ヘリコンスパッタリング装置	アルバック	MPS-4000C1/HC1	13,200	3,500	4,700	7,900	9,100	12,300	13,500
AP-200009	イオンビームスパッタ装置	アルバック	IBS-6000S	13,200	1,500	2,000	5,900	6,400	10,300	10,800
AP-200010	原子層堆積装置	ピコサン	SUNALE-R	13,200	2,900	5,100	7,300	9,500	11,700	13,900
AP-200012 AP-200013	反応性イオンエッチング装置	サムコ	RIE-101iPH RIE-10NRV	13,200 13,200	2,200	4,300 4,000	6,600	8,700 8,400	11,000	13,100 12,800
AP-200013	反応性イオンエッチング装置 ドライエッチング装置	アルバック	NLD=500	13,200	2,200 1,200	1,800	5,600	6,200	10,000	10,600
AP-200015	イオンミリング装置	アルバック	IBE-6000S	13,200	1,100	1,500	5,500	5,900	9,900	10,300
AP-200017	電界放射型走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM-6700FT	22,000	1,100	1,100	5,500	5,500	9,900	9,900
AP-200018	電子ビーム描画装置	エリオニクス	ELS-3700	26,400	1,000	1,800	5,400	6,200	9,800	10,600
AP-200019	電子線描画装置	エリオニクス	ELS-7300	70,400	1,700	5,000	6,100	9,400	10,500	13,800
AP-200020	両面マスクアライナ	ズースマイクロテック	MA-6	17,600	900	2,900	5,300	7,300	9,700	11,700
AP-200021	ECR加工装置	エリオニクス	EIS-200ER	44,000	1,000	1,500	5,400	5,900	9,800	10,300
AP-200022	ICP加工装置	エリオニクス	EIS-700S	26,400	1,000	1,000	5,400	5,400	9,800	9,800
AP-200023	超高真空5源ヘリコンスパッタ	菅製作所 Cambride NanoTech	Av028	26,400	1,300	2,400	5,700	6,800	10,100	11,200
AP-200024 AP-200026	ALD製膜装置 スパッタ装置	Cambride NanoTech キャノンアネルバ	Savannah 100 SPF-210H	26,400 26,400	1,500 300	2,700 500	5,900 4,700	7,100 4,900	10,300 9,100	11,500 9,300
AP-200026 AP-200027	スパッタ装直 EB加熱・抵抗加熱蒸着装置	キャノン アネルバ アルバック	SPF-210H EBX-8C	26,400 35,200	2,100	2,400	4,700 6,500	4,900 6,800	10,900	9,300
AP-200028	EB加熱·抵抗加熱蒸着装置	菅製作所	AV096-000	17,600	1,700	2,700	6,100	7,100	10,500	11,500
AP-200029	FIB加工装置	エリオニクス	EIP-3300	44,000	1,500	1,900	5,900	6,300	10,300	10,700
AP-200057	ナノカーボン成長炉	ナノデバイス	Easy tube system	44,000	400	400	4,800	4,800	9,200	9,200
AP-200058	エリプソメーター	日本分光	M-500S	6,200	200	700	4,600	5,100	9,000	9,500
AP-200059	超高速スキャン高精度電子ビーム露光装置	エリオニクス	ELS-F130HM	35,200	6,900	26,600	11,300	31,000	15,700	35,400
AP-200060	半導体薄膜堆積装置	パスカル	PAC-LMBE	35,200	2,400	5,800	6,800	10,200	11,200	14,600
AP-200063	電子線三次元粗さ解析装置	エリオニクス	ERA-8000FE	35,200	1,200	1,300	5,600	5,700	10,000	10,100
AP-200066	コンパクトスパッタ装置	アルバック	ACS-4000-C3-HS	13,200	2,900	4,700	7,300	9,100	11,700	13,500
AP-200067 AP-200068	ICP高密度プラズマエッチング装置 スパッタ装置	サムコ 菅製作所	RIE-101iHS SSP3000Plus	13,200 26,400	1,900	5,700 1,500	6,300 5,100	10,100 5,900	10,700 9,500	14,500 10,300
AP-200069	ダイシングソー	DISCO	DAD322	17,600	700	1,000	5,100	5,400	9,500	9,800
AP-200072	多元スパッタ装置	アルバック	QAM-4-ST	26,400	5,500	7,000	9,900	11,400	14,300	15,800
AP-200073	シリコン深堀りエッチング装置	SPPテクノロジーズ	APX-ASE-Pegasus-Polestar	35,200	4,300	9,500	8,700	13,900	13,100	18,300
AP-200074	電子ビーム蒸着装置	エイコーエンジニアリング	EB-580S	26,400	2,100	2,800	6,500	7,200	10,900	11,600
AP-200075	レーザー顕微鏡	キーエンス	VK-9700/9710	26,400	700	1,400	5,100	5,800	9,500	10,200
AP-200076	UV-オゾンクリーナー	サムコ	UV-1	8,800	600	600	5,000	5,000	9,400	9,400
AP-200077	光学干涉式膜厚計	フィルメトリクス	F20-UV	26,400	700	900	5,100	5,300	9,500	9,700
AP-200078	原子層堆積装置(粉末対応型)	ピコサン	R-200 advanced	26,400	4,100	7,400	8,500	11,800	12,900	16,200
AP-200034 AP-200035	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM) 超高真空・極低温・高磁場SPM (LT-UHV-SPM)	日本電子	JSM-6500F JAFM4500LT	35,200 26,400	2,200 1,500	4,300 6,900	6,600 5,900	8,700 11,300	11,000	13,100 15,700
AP-200035	超高圧電子顕微鏡群	日本電子	JAFM4500L1 IEM-ARM1300	70,400	3,600	5,000	8,000	9,400	12,400	13,800
AP-200039	電界放射型電子顕微鏡(200kV FEG-TEM)	日本電子	IEM-2010F	70,400	2,400	2,400	6,800	6,800	11,200	11,200
AP-200041	超薄膜評価装置	日立	HD-2000	17,600	2,600	7,000	7,000	11,400	11,400	15,800
AP-200042	集束イオンビーム加工観察装置	日立	FB-2100	22,000	2,300	4,600	6,700	9,000	11,100	13,400
AP-200043	透過電子顕微鏡(TEM)	日本電子	JEM-2010	35,200	2,200	4,300	6,600	8,700	11,000	13,100
AP-200045	フィールドエミッション電子ブローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)	日本電子	JXA-8530F	35,200	3,600	8,400	8,000	12,800	12,400	17,200
AP-200046	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)	日本電子	JIB-4601F	35,200	3,400	5,600	7,800	10,000	12,200	14,400
AP-200047	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)EDS・EBSDオプション	日本電子	(ED-2300(EDS)/IB-2300G/THDEBS(ERSE)	0	400	800	400	800	400	800
AP-200052	オージェ電子分光装置 ソ領火電スハ火井票	日本電子	JAMP-9500F	35,200	2,300	7,800	6,700	12,200	11,100	16,600
AP-200053 AP-200054	X線光電子分光装置 スピンSEM	日本電子	JPS-9200	35,200 26,400	1,800	5,400	6,200	9,800	10,600	14,200
AP-200054 AP-200055	スピンSEM 超高真空STM・スピン偏極STM装置	オミクロン	STM/AFM, VT-STM	26,400 26,400	2,200 3,000	2,600 4,600	6,600 7,400	7,000 9,000	11,000 11,800	11,400 13,400
AP-200056	時間分解光電子顕微鏡システム	エルミテック	PEEM-III	140,800	2,600	5,500	7,000	9,900	11,400	14,300
AP-200061	高分解能3次元構造評価装置	日本FEI	Titan3 G2 60-300	70,400	7,400	29,800	11,800	34,200	16,200	38,600
AP-200062	収差補正走査型透過電子顕微鏡	日本電子	JEM-ARM200F	44,000	5,100	15,900	9,500	20,300	13,900	24,700
AP-200064	走査型プローブ顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー	NanoNavi Station SPA300	35,200	200	400	4,600	4,800	9,000	9,200
AP-200065	超高真空AFM	日本電子	JAFM-4500XT	211,200	1,200	1,600	5,600	6,000	10,000	10,400
AP-200070	大気中光電子分光装置	理研計器	AC-3	13,200	2,200	4,200	6,600	8,600	11,000	13,000
AP-200071	超高分解能走查型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	SU8230	26,400	2,300	4,500	6,700	8,900	11,100	13,300
AP-200079	精密イオンミリングシステム	日本ガタン	PIPSII model 695	35,200	1,300	1,400	5,700	5,800	10,100	10,200
AP-200080 AP-200081	レーザー描画装置 集束イオンビーム加工観察装置	ハイデルベルグ 日本電子	DWL66+ JEM-9320FIB	35,200 0	5,000 2,100	8,500 4,800	9,400 6,500	12,900 9,200	13,800 10,900	17,300 13,600
AP-200081		日本電子	JEM-9320F1B IPS-9200	30,800	1,600	4,800 5,300	6,000	9,200	10,400	14,100
-	X線光電子分光装置 プラブーボ原子展接待法器		*							
AP-200083	プラズマ式原子層堆積装置	サムコ	AD-230LP-H	35,200	4,400	10,300	8,800	14,700	13,200	19,100
AP-200084	卓上型ランプ加熱装置	アドバンス理工	MILA-5000-P-N	35,200	1,600	1,700	6,000	6,100	10,400	10,500
AP-200085	量子・電子制御ナノマテリアル顕微物性測定装置	日本電子	JEM-ARM200F NEOARM	35,200	5,200	12,200	9,600	16,600	14,000	21,000
AP-200086	ガラスインプリント装置	東芝機械	GMP-415V	35,200	2,000	4,600	6,400	9,000	10,800	13,400
AP-200087	顕微紫外可視分光装置	日本分光	MSV-5200	8,800	2,100	3,200	6,500	7,600	10,900	12,000
AP-200088	微細形状測定機	小坂研究所	ET200	17,600	600	800	5,000	5,200	9,400	9,600
AP-200089	マニュアルスパッタ	自作	-	17,600	700	1,100	5,100	5,500	9,500	9,900
AP-200090	ラマンイメージング装置	堀場製作所	HR-Evolution type pa nano	26,400	2,900	4,200	7,300	8,600	11,700	13,000
		-			-					

技術支援料(サンブル前処理・設計等)	技術相談料		
4,400円 / 時間			
(ただし、高度な知識及び経験を必要とされる作業、複数の技術を組み合わせる作業、その他の難易 度の高」、作業を伴う場合にあっては8,800円)	11,000円 / 時間		

【 支援装置料金表<データ提供**なし**> 】2024年4月1日 改定

北海道大学 ナノテクノロジー連携研究推進室

Page				北海道大学 ナノテ	//- v AEI/		(m (u)	44-Or-Abril	fol (PT (++)	44.05.15.45	fol (m (++)
CHAPTER OF - MARKER 1970 1974-77 1974-78 1974-79 1974-	設備番号	装置名	メーカー	型式	初回講習料						
Parent		物を検査のできます。) 株式状態 105117	Harbert Bross	DLO DIOS II	05.000	公的機関)	_	公的機関)		公的機関)	学外者(一般)
1999 19				LLO I ILO C							19,500 17,600
2000 一子・神経音音					-						11,400
1-2-100 日本日本日報 1-7-107 13-100 1-30											12,600
1-90-00 「アンドバアンの設置											11,300
Program 1998年の大学の大学展開				PD-220ESN							14,500
2000 「イヤビームへいらが異常	AP-200007	液体ソースプラズマCVD装置	サムコ		22,000			5,200	5,400	9,600	9,800
Propose 日子田神経世紀 19-92	AP-200008	ヘリコンスパッタリング装置	アルバック	MPS-4000C1/HC1		4,400					14,800
Para	AP-200009	イオンビームスパッタ装置	アルバック	IBS-6000S	13,200	1,900	2,600	6,300	7,000	10,700	11,400
2-2009 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	AP-200010	原子層堆積装置	ピコサン	SUNALE-R	13,200	3,700	6,500	8,100	10,900	12,500	15,300
Program アイ・アイア アイ・アクト	AP-200012	反応性イオンエッチング装置	サムコ	RIE-101iPH	13,200	2,900	5,500	7,300	9,900	11,700	14,300
Page 2007 日田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	AP-200013	反応性イオンエッチング装置	サムコ	RIE-10NRV	13,200	2,800	5,200	7,200	9,600	11,600	14,000
### 2000	AP-200014	ドライエッチング装置	アルバック	NLD-500	13,200	1,500	2,300	5,900	6,700	10,300	11,100
Processon 女子で一角が開発 1967年7月 1967年7日	AP-200015	イオンミリング装置	アルバック	IBE-6000S	13,200	1,400	1,900	5,800	6,300	10,200	10,700
2000 2 子田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	AP-200017	電界放射型走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM-6700FT	22,000	1,400	1,400	5,800	5,800	10,200	10,200
Personne 1997 1	AP-200018	電子ビーム描画装置	エリオニクス	ELS-3700	26,400	1,300	2,300	5,700	6,700	10,100	11,100
**Part	AP-200019			ELS-7300	70,400			6,600	10,800		15,200
19-2-2002 中国では原理											12,600
Page 2000 日本学の					-						10,700
A-202004 人の表質を受ける 1.0.100 1.0.200											10,100
2-2-2002 パーケ型原質 ターケンダネッド 201-1011 201-101											11,900
Pro											12,300
中央-2000 加田田・北京市会議院 教育所 か1980-600 11 00 2,00 3,500 6,00 7,500 19,000					-						9,400
中の日の日 日の日の日 日の											11,900
## 20000											12,300 11,300
## 20000			- /~- / / /								9,300
□- 20000					-						9,700
## 20000											43,000
## 2-20000 配子報三次末出多解音響											16,200
## 200008	AP-200063		エリオニクス	ERA-8000FE	35,200	1,500	1,600	5,900	6,000	10,300	10,400
## 200008	AP-200066		アルバック	ACS-4000-C3-HS	13,200	3,800	6,100	8,200	10,500	12,600	14,900
AP-20008 ダイングツー DISCO DADS22 17,800 800 1,300 5,300 5,700 9,600 11,500	AP-200067	ICP高密度プラズマエッチング装置	サムコ	RIE-101iHS	13,200	2,400	7,300	6,800	11,700	11,200	16,100
AP-200017 タラルベッタ製置 アルイック QAM-4-ST 26,400 7,100 9,000 11,500 13,400 16,500 11,400 14,300 12,400 20,000 20,000 20,000 3,000 16,500 11,400 14,300 21,000 20,000 20,000 3,000 11,400 14,300 21,000 20,000 20,000 3,000 11,400 14,300 21,000 20,000 20,000 3,000 11,400 14,300 21,000 20,000 20,000 3,000 11,400 11,400 11,400 12,000 20,000 2	AP-200068	スパッタ装置	菅製作所	SSP3000Plus	26,400	800	2,000	5,200	6,400	9,600	10,800
AP-200012 シヴェン深電形ンエッチング装置 SFPテク/ロジース 中心の中心の 35,200 5,500 12,200 9,00 16,600 14,00 21 AP-200018 レベーナングリーナー サムコ (ハーコール・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・ア	AP-200069	ダイシングソー	DISCO	DAD322	17,600	800	1,300	5,200	5,700	9,600	10,100
AP-200075 レーザー製剤機 キーエーンジェアリック 2B-580S 25,400 2,600 3,600 7,000 8,000 11,400 11 AP-200075 レーザー製剤機 キーエンス VN-9700/9710 26,400 900 1,800 5,000 6,200 9,700 11 AP-200077 光学下が大阪専学計 フィルカリック PD-1V 25,400 800 11,00 5,200 5,200 9,600 5 AP-200077 光学下が大阪専学計 フィルカリックス PD-1V 25,400 800 1,100 5,200 9,600 13,000 14,000 17 AP-200078 所不着単純検護機 的大学が立め 1 本電子 SM-5500F 3,500 2,000 9,600 13,000 14,000 11,000 17 AP-200086 超延圧電子解放機の 日本電子 JN-N4500LT 25,400 1,000 8,500 6,300 13,200 10,700 17 AP-20008 超延圧電子解放機が B A 表 JN-N4500LT 25,400 1,000 8,500 6,300 13,200 10,700 17 AP-20004	AP-200072	多元スパッタ装置	アルバック	QAM-4-ST	26,400	7,100	9,000	11,500	13,400	15,900	17,800
AP-200071 レーザー製商競 キーエンス VK-9700/9710 25,400 900 1,800 5,300 6,200 9,700 11 AP-200071 VV-オン/ングリーナー サムコ 1VV-1 8,800 800 800 5,200 9,600 13,000 9,600 1 AP-200071 原子管性は関連 2 24人が与ッス PD-1V 26,400 800 1,100 5,500 9,600 13,000 14,000 19 AP-200071 原子管性は関連 2 24人が与ッス PD-1V 26,400 800 1,100 5,500 9,600 13,500 14,000 19 AP-200072 地の大きでは関連性 2 24人が与ッス PD-1V 26,400 5,200 9,500 9,600 13,500 14,000 19 AP-200072 地の大きでは関連性 3 1本電子 JAF-44500LT 26,400 1,000 8,600 9,600 13,500 10,700 11 AP-200072 地の大きでは関連性 3 1本電子 JAF-44500LT 26,400 1,000 8,600 9,000 13,200 10,700 11 AP-200072 機能性電子機能機能のW FEG-TEAD 1 本電子 JAF-4450LT 70,400 4,600 6,400 9,000 13,400 11 AP-200073 機能を発音機能機能のW FEG-TEAD 1 本電子 JAF-4500LT 70,400 3,300 9,000 7,700 1,000 11,700 11 AP-200074 機能を手機機能のW FEG-TEAD 1 本電子 JAF-4500LT 70,400 3,300 9,000 7,700 1,000 11,700 11 AP-200075 機能を手機機能のW FEG-TEAD 1 本電子 JAF-4500LT 70,400 3,300 9,000 7,700 1,000 11,700 11 AP-200076 透音音子機能検性 74 ME PD-200 1 1 未電子 JAF-4500LT 70,400 3,300 9,000 7,700 1,000 11,700 11 AP-200076 活動を小きに乗り返回にはからいました。 JAF-200 22,000 2,000 6,000 7,300 10,000 11,700 11 AP-200077 かったしましましましましましましましましましましましましましましましましましましま	AP-200073	シリコン深堀りエッチング装置	SPPテクノロジーズ	APX-ASE-Pegasus-Polestar	35,200	5,500	12,200	9,900	16,600	14,300	21,000
AP-200077 光子下序式解写計	AP-200074	電子ビーム蒸着装置	エイコーエンジニアリング	EB-580S	26,400	2,600	3,600	7,000	8,000	11,400	12,400
AP-20007	AP-200075	レーザー顕微鏡	キーエンス	VK-9700/9710	26,400	900	1,800	5,300	6,200	9,700	10,600
AP-200078 原子相植精質変化物対応型)	AP-200076	UV-オゾンクリーナー	サムコ	UV-1	8,800	800	800	5,200	5,200	9,600	9,600
AP-200055 からいか - 中のでは、	AP-200077	光学干涉式膜厚計	フィルメトリクス	F20-UV	26,400	800	1,100	5,200	5,500	9,600	9,900
AP-200058 起馬京平・衛田県・高岡県町田川江十3ト・3中の 日本電子 JAFM4500LT 26,400 1,900 8,800 6,300 13,200 10,700 1 1 AP-200058 超高圧電子顕微鏡酵き 日本電子 JEM-ARM1300 70,400 4,600 6,400 9,000 10,800 13,400 18 AP-200058 電馬政計電子調面就2000V FEG-TEAN 日本電子 JEM-2010F 70,400 3,100 7,500 7,500 7,500 11,900 11 AP-200052 電馬政計電子調面就2000V FEG-TEAN 日本電子 JEM-2010F 70,400 3,100 7,500 7,500 11,900 11 AP-200042 電東文インビー人加工観察装置 日立 HP-2000 17,600 3,300 9,000 7,700 13,400 12,100 12 AP-200043 透過電子顕微鏡でENO 日本電子 JEM-2010 35,200 2,800 6,600 7,300 10,400 11,700 14 AP-200043 透過電子顕微鏡でENO 日本電子 JEM-2010 35,200 4,600 10,800 9,000 15,200 13,400 11 AP-200045 透過電子顕微鏡でENO 日本電子 JEM-2010 35,200 4,600 10,800 9,000 15,200 13,400 15 AP-200047 電ビームル工服装験で配付形でデーターのでは、日本電子 JEM-2010 35,200 4,600 10,800 9,000 15,200 13,400 15 AP-200047 電ビームル工服装験で配付形でSEO 日本電子 JEM-2010 35,200 4,600 10,800 9,000 11,500 13,100 15 AP-200047 電ビームル工服装験で置付用でSEO 日本電子 JEM-2010 35,200 1,000 500 1,00	AP-200078		ピコサン	R-200 advanced	26,400	5,200	9,500	9,600			18,300
AP-200038 超馬庄電子顕微鏡館 日本電子 JEM-ARM1300 70,400 4,600 6,400 9,000 10,800 11,400 11 AP-200038 電馬放性関電子顕微鏡のNY FEG-TEM 日本電子 JEM-2010F 70,400 3,100 7,500 7,500 11,900 11 AP-20004日 超薄軽評価装置 日立 HD-2000 17,600 3,300 9,000 7,700 13,400 11,100 11 AP-20004日 超薄性子の大きにより 日本電子 JEM-2010 35,200 2,900 6,000 7,300 10,400 11,700 14 AP-20004日 透過電子顕微鏡(TEM D 日本電子 JEM-2010 35,200 2,800 5,600 7,200 10,000 11,600 14 AP-20004日 ボールドルシルの工服解装置 日本電子 JEM-2010 35,200 4,600 10,800 9,000 15,200 13,400 13,400 15 AP-20004日 混合ドルールコ工服解装置(TBN-SEM D 日本電子 JRN-65850F 35,200 4,600 10,800 9,000 15,200 13,400 15 AP-20004日 混合ドルールコ工服解装置(TBN-SEM D 日本電子 JRN-65850F 35,200 4,600 10,800 9,000 15,200 13,100 15 AP-20004日 混合ドルールコ工服を影響の出始が出からいた。 日本電子 JRN-601F 35,200 4,300 7,100 8,700 11,500 11,500 11 AP-20005日 混分光電を発音のよりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによ				J							14,300
AP-20008 世界後世電子頻繁微2004V FEX-TEM) 日本電子 IEM-2010F 70,400 3,100 3,100 7,500 11,900 11 AP-20041 超薄標野能装置 日立 HD-2000 17,600 3,300 9,000 7,700 13,400 12,100 17 AP-20042 葉東オケンピーム加工観察装置 日立 FB-2100 22,000 2,900 6,000 7,300 10,400 11,700 11 AP-20042 葉東オケンピーム加工観察装置 日立 FB-2100 22,000 2,900 6,000 7,300 10,400 11,700 11 AP-20045 芸術学研究がETMD 日本電子 DXA-8530F 35,200 4,600 10,500 9,000 15,200 13,400 15 AP-20046 指合ピーム加工観察装置FB-SEM 日本電子 DXA-8530F 35,200 4,600 10,500 9,000 15,200 13,400 15 AP-200047 電かて小原工観察装置FB-SEM 日本電子 BB-461F 35,200 4,500 7,100 8,700 11,500 13,400 15 AP-200047 電かて小原工影響影響が出るにおいまいたサールドライン・日本電子 BB-461F 35,200 4,500 7,100 8,700 11,500 13,400 15 AP-200057 電かて小原工器等影響が出るにおいまいたサール 日本電子 BB-461F 35,200 4,300 7,100 8,700 11,500 13,400 15 AP-200058 X機光電子分光装置 日本電子 JPS-9200 35,200 2,300 6,900 6,700 11,300 11,100 15 AP-200058 XEX-REAL TAME TO T					-						17,600
AP-20004 超薄膜肝循接壁 目立 HD-2000 17,600 3,300 9,000 7,700 13,400 12,100 17 AP-20042 葉末イナンビーA加工観察装置 日立 FB-2100 22,000 2,500 6,000 7,300 10,400 11,700 1:4 AP-20043 透通電子解放験でFEM 日本電子 JEM-2010 35,200 2,500 5,600 7,200 10,000 11,600 11 AP-20046				*							15,200
AP-200042 業東イオンピーム加工観察装置 日立 FB-2100 22,000 2,900 6,000 7,300 10,400 11,700 14 AP-200045 き適電子顕微鏡(TEND) 日本電子 JEM-2010 35,200 2,800 5,600 7,200 10,000 11,600 1. AP-200047 アールドール・アードードードードール・アードードール・アール・アードール・アードール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・ア				J							11,900 17,800
AP-200048 2000年											14,800
AP-200048 (上のインシンの後でアーナイヤのアナウイのできるMAD 日本電子 DAR-8530F 35,200 4,600 10,800 9,000 15,200 13,400 15 AP-200048 復合ビーム加工観察装置(FIB-SEM) 日本電子 JBB-4661F 35,200 4,300 7,100 8,700 11,500 13,100 15 AP-200047 後で一かに実験機能が明めばないがあります。 日本電子 JBM-9500F 35,200 3,000 10,000 500 1,000 500 1,000 500 JAP-200053 X線光電子分光装置 日本電子 JAMP-9500F 35,200 3,000 10,000 7,400 14,400 11,800 18 AP-200053 X線光電子分光装置 日本電子 JPS-9200 35,200 2,300 6,900 6,700 11,300 11,100 15 AP-200058 経過度では、アンシンの 57M/AFM、VT-STM 26,400 2,800 3,300 7,200 7,700 11,600 12 AP-200058 時間分解光電子顕微鏡 オネラロン STM/AFM、VT-STM 26,400 3,900 5,900 8,300 10,300 12,700 14 AP-200058 内臓分解光電子顕微鏡 日本電子 JEM-ARM200F 44,000 6,500 20,500 10,300 42,700 18,300 44 AP-200058 超高真空STM・スピン偏極STM装置 日本電子 JAFM-4500XT 211,200 9,500 38,300 13,900 42,700 18,300 44 AP-200058 超高真空AFM 日本電子 JAFM-4500XT 211,200 1,500 2,000 5,900 6,000 10,300 11,700 14 AP-200070 大気中光電子分光装置 理解計器 AC-3 13,200 2,900 5,800 7,300 9,800 11,700 14 AP-200070 大気中光電子分光装置 理解計器 AC-3 13,200 2,900 5,800 7,300 9,800 11,700 14 AP-200070 情能イオンジングンステム 日本ガタン FIRSI model 695 35,200 10,000 5,900 6,000 10,300 11 AP-200070 情能イオンジングンステム 日本ガタン FIRSI model 695 35,200 10,000 5,000 10,000 11,000 11 AP-200080 単一・指摘装置 アドベンス理工 MILA-5000-PN 35,200 5,000 10,900 10,000 11,000 11 AP-200080 単一・指摘装置 アドベンス理工 MILA-5000-PN 35,200 5,000 10,000 10,000 11,000 11,000 11 AP-200080 単一・指摘装置 アドベンス理工 MILA-5000-PN 35,200 5,000 5,000 7,000 10,300 11,000 11 AP-200080 単一・指摘装置 アドベンス理工 MILA-5000-PN 35,200 5,000 5,000 7,000 10,300 11,000 11 AP-200080 プラズマズ原子屋壁積装置 アドベンス理工 MILA-5000-PN 35,200 5,000 5,000 5,000 10,300 11,000											14,400
AP-20004 複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM) 日本電子 JB-4601F 35,200 4,300 7,100 8,700 11,500 13,100 16 AP-200047 常のビーム加工観察装置(FIB-SEM) 日本電子 JBMP-9500F 35,200 3,000 10,000 7,400 14,400 11,800 18 AP-20005X 終光電子分光装置 日本電子 JAMP-9500F 35,200 2,300 6,900 6,700 11,300 11,100 17 AP-20005X 終光電子分光装置 日本電子 JBMP-9200 35,200 2,300 6,900 6,700 11,300 11,100 17 AP-20005X 程序分光装置 日本電子 JBMP-9200 35,200 2,300 6,900 6,700 11,300 11,100 17 AP-20005X 程序分光装置 日本電子 JBMP-9200 35,200 2,300 6,900 6,700 11,300 11,100 17 AP-20005X 程序分光速度 日本電子 JBM-84EM200F 26,400 2,800 3,900 7,200 7,700 11,600 12 AP-20005X 程序分光速子系数数 日本年日 Titan3 G2 60-300 70,400 9,500 33,300 13,900 42,700 18,300 11,200 12,200 15 AP-20005X 建新正差型透過電子顕微鏡 日本電子 JBM-84EM200F 44,000 6,500 20,500 10,900 24,900 15,300 25 AP-20005X 経済変化所外 日本電子 JBM-84EM200F 44,000 6,500 20,500 10,900 24,900 15,300 25 AP-20005X 経済変化所外 日本電子 JBM-84EM200F 44,000 6,500 20,500 10,900 24,900 11,700 14 AP-20007X 程序分析能差を整理電子顕微鏡 日本電子 JBM-84EM200F 44,000 5,500 5,900 6,400 10,300 11 AP-20007X 経済変化所外 日本電子 JBM-84EM200F 44,000 5,500 5,900 6,400 10,300 11 AP-20007X 程序分析能差を整理電子顕微鏡 日本電子 JBM-84EM200F 44,000 5,500 5,900 6,400 10,300 11 AP-20007X 程度分析能差を整理を対した JBM-84EM200F 44,000 5,500 5,900 6,400 10,300 11 AP-20007X 程度分析能差を整理を対した JBM-84EM200F 44,000 5,500 5,900 6,400 10,300 11 AP-20008X 経済変化所外 日本電子 JBM-84EM200F 35,200 1,700 1,800 6,100 6,200 11,700 14 AP-20007X 程度分析能差を整理を対した JBM-84EM200F AP-20008X 日本で子 JBM-84											19,600
AP-20005											15,900
AP-200052 オージェ電子分光装置 日本電子 JAMP-9500F 35,200 3,000 10,000 7,400 14,400 11,800 18 AP-200053 X線光電子分光装置 日本電子 JPS-9200 35,200 2,300 6,900 6,700 11,300 11,100 12 AP-200054 スピンSEM インコント インコント 25,400 2,800 3,300 7,200 7,700 11,600 12 AP-200055 超高真空STM・スピン偏極5TM 装置 オンコント STM/AFM LVT-STM 26,400 3,900 5,900 8,300 10,300 12,200 14 AP-200068 時間分解光電子振微微鏡システム エルミテック PTEM-III 140,800 3,400 7,100 7,800 11,500 12,200 16 AP-200061 高分解態3次元構造書価報表置 日本電子 JEM-ARM200F 44,000 6,500 38,300 13,900 42,700 18,300 42 AP-200062 校業が出まると表現では、安全を選びて一プ顕微鏡 日本電子 JAFM-4500XT 21,200 1,500 20,500 10,900 24,900 15,300 22 AP-20007 大気中電電子分栄装置 理研計器 AC-3 13,200 2,900 5				ptb-2000(05)/88-21006(T00686(ER6D)							1,000
AP-20005				JAMP-9500F	35,200						18,800
AP-200054					-						15,700
AP-200056 時間分解光電子顕微鏡システム エルミテック PEEM-III 140,800 3,400 7,100 7,800 11,500 12,200 II AP-200066 高分解総3次元構造評価装置 日本FEI Titan3 G2 60-300 70,400 9,500 38,300 13,900 42,700 18,300 44 AP-200062 収差補正走査型活過電子顕微鏡 日本電子 JEM-ARM200F 44,000 6,500 20,500 10,900 24,900 15,300 25 AP-200068 極高英空AFM 日本電子 JAFM-4500XT 211,200 1,500 2,000 5,900 6,400 10,300 16 AP-200070 大気中光電子分光装置 埋研計器 AC-3 13,200 2,900 5,800 7,300 19,800 11,700 14 AP-200071 超高分解能走差型電子顕微鏡 日本イテクロジーメントラロジーメントラリニン・スリスティン・スリ		スピンSEM									12,100
AP-20008 高分解館3次元構造評価装置 日本FEI Titan3 G2 60-300 70,400 9,500 38,300 13,900 42,700 18,300 47 AP-200082 校差補正赴査型活過電子顕微鏡 日本電子 JEM-ARM200F 44,000 6,500 20,500 10,900 24,900 15,300 25 AP-200085 超高英名AFM 日本電子 JAFM-4500XT 211,200 1,500 2,000 5,900 6,400 10,300 16 AP-200070 大気中光電子分光装置 理研計器 AC-3 13,200 2,900 5,400 7,300 9,800 11,700 14 AP-200071 超高分解能走査型電子顕微鏡 日本ペイテク/ロシーズ SU8230 26,400 2,900 5,800 7,300 9,800 11,700 14 AP-200071 超高分解能走査型電子顕微鏡 日本ペイテク/ロシーズ SU8230 1,700 1,800 6,100 6,200 10,500 11 AP-200081 単東イオンジリングシステム 日本ガンシ PPSII model 695 35,200 1,700 1,800 6,100 6,200 10,500 15 AP-200081 集東イオンジリングシステム 日本ガンシ PPSII model 695 35,200 6,400 10,900 10,800 15,300 15,300 15,200 15 AP-200082 X線光電子分光装置 日本電子 JEM-9320FIB 0 2,700 6,200 7,100 10,600 11,500 15 AP-20083 プラズマ式原子層埋積装置 サムコ AD-230LP-H 35,200 5,700 13,200 10,100 17,600 14,500 22 AP-20084 卓上型ランブ加熱装置 アドバンス理工 MILA-5000-P-N 35,200 2,100 6,800 6,500 11,100 17,600 14,500 24 AP-20088 黄子・電子朝神ナンマサアル編集物性測定接触 日本電子 JEM-MARGROW NEOAMM 35,200 5,900 7,000 10,300 11,400 14 AP-20088 黄河スインブリント装置 東芝機械 GMP-415V 35,200 2,600 5,900 7,000 10,300 11,400 14 AP-20088 微研形状測定機 小坂研究所 ET200 17,600 800 1,100 5,200 5,500 9,600 5	AP-200055		オミクロン	STM/AFM, VT-STM							14,700
AP-200062 収発補正定査型透過電子顕微鏡 日本電子 JEM-ARM200F 44,000 6,500 20,500 10,900 24,900 15,300 25 AP-200064 主変型プロープ顕微鏡 =27(アイナイアカアレーン Samblerd Stations SPA300 35,200 200 400 4,600 4,800 9,000 5 AP-200005 超高資金AFM 日本電子 JAFM-4500XT 211,200 1,500 2,000 5,900 6,400 10,300 11 AP-200070 大気中光電子分光装置 理研計器 AC-3 13,200 2,900 5,400 7,300 9,800 11,700 14 AP-200071 超高分解能走室型電子顕微鏡 日本ペイテックロジェイ SUB2330 26,400 2,900 5,400 7,300 10,200 11,700 14 AP-200081 基本インジンステム 日本ガン/ PPISII model 695 35,200 1,700 1,800 6,100 6,200 10,500 15,300 15,200 15 AP-200082 大瀬大電大大変配 日本電子 JEM-9320FIB 0 2,700 6,200 7,100 10,600 11,500	AP-200056	時間分解光電子顕微鏡システム	エルミテック	PEEM-III	140,800	3,400	7,100	7,800	11,500	12,200	15,900
AP-200064 走変型プロープ顕微鏡 ニスイアイトアテルシー NamaNaria Sastinas SPA300 35,200 200 400 4,600 4,800 9,000 6 AP-200065 超高質型AFM 日本電子 JAFM-4500XT 211,200 1,500 2,000 5,900 6,400 10,300 16 AP-200070 大坂中光電子分光装置 理研計器 AC-3 13,200 2,900 5,400 7,300 9,800 11,700 14 AP-200071 居高分解能走室型電子顕微鏡 日本グイアノジレンス BEX300 26,400 2,900 5,800 7,300 10,200 11,700 14 AP-200071 精密イオンジリングシアシスム 日本ガングールグンクンスム 日本ガングールグリングールグラックを開発を開発を開発を開発を開発を開始を開発を開始を開始を開発を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を	AP-200061	高分解能3次元構造評価装置	日本FEI	Titan3 G2 60-300	70,400	9,500	38,300	13,900	42,700	18,300	47,100
AP-200065 極高質至AFM 日本電子 JAFM-4500XT 211,200 1,500 2,000 5,900 6,400 10,300 10 AP-200070 大気中光電子分光装置 埋研計器 AC-3 13,200 2,900 5,400 7,300 9,800 11,700 14 AP-200071 極高分解能走查型電子顕微鏡 日本ハイタクルシステム BL8230 26,400 2,900 5,800 7,300 10,200 11,700 14 AP-200079 情能不才ンジリングシステム 日本ガクン PIFSIII model 695 35,200 1,700 1,800 6,100 6,200 10,500 15 AP-200080 レーザー補面接置 ハイデルベルグ DML66+ 35,200 6,400 10,900 15,300 15,200 15 AP-20088 集まイオンビーム加工製験装置 日本電子 JEM-9320FIB 0 2,700 6,200 7,100 10,600 11,500 15 AP-20088 大学大変量 日本電子 JPS-9200 30,800 2,100 6,800 6,500 11,200 10,900 16 AP-20088 本P-2008 TP-2008 TP-2008 TP-2008 TP-2008 TP-2008 TP-2008 TP-	AP-200062	収差補正走査型透過電子顕微鏡	日本電子	JEM-ARM200F	44,000	6,500	20,500	10,900	24,900	15,300	29,300
AP-200000 大気中光電子分光装置 埋研計器 AC-3 13,200 2,900 5,400 7,300 9,800 11,700 14 AP-200071 超高分解能走查型電子顕微鏡 日本ハイテク/ロジーX SU8230 26,400 2,900 5,800 7,300 10,200 11,700 14 AP-200079 情能イオンミリングシステム 日本ガタン PIPSII model 695 35,200 1,700 1,800 6,100 6,200 10,500 16 AP-200080 レーザー措画装置 ハイデルベルグ DWL66+ 35,200 6,400 10,900 15,300 15,200 15 AP-200081 集束イオンピーム加工観察装置 日本電子 JEM-9320FIB 0 2,700 6,200 7,100 10,600 11,500 15 AP-200082 X線光電子分光装置 日本電子 JEM-9320FIB 0 2,700 6,800 6,500 11,200 10,900 15 AP-200083 プラズマズ氏原子母維積装置 サムコ AD-230LP·H 35,200 5,700 13,200 10,100 17,600 14,500 2 AP-200084 卓上型ランブ加熱装置 アドベス理工<	AP-200064	走査型プローブ顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー	NanoNavi Station SPA300	35,200	200	400	4,600	4,800	9,000	9,200
AP-20007 超高分解能走査型電子顕微鏡 日本ハイテク/ロジーズ SUB230 26,400 2,900 5,800 7,300 10,200 11,700 14 AP-200079 精密イオンミリングシステム 日本ガタン PIPSII model 695 35,200 1,700 1,800 6,100 6,200 10,500 10 AP-200080 レーザー捕画装置 ハイデルベルグ DWL66+ 35,200 6,400 10,900 10,800 15,300 15,200 15 AP-200081 集束イオンビーム加工観察装置 日本電子 JEM-9320FIB 0 2,700 6,200 7,100 10,600 11,500 15 AP-200082 X線光電子分光装置 日本電子 JPS-9200 30,800 2,100 6,800 6,500 11,200 10,900 15 AP-200083 プラズマ式原子圏堆積装置 サムコ AD-230LP・H 35,200 5,700 13,200 10,100 17,600 14,500 22 AP-200083 摩オ・電子制御ナハテリアル網像物性測定装置 アドバンス理工 MILA-500のP-N 35,200 2,100 6,500 6,500 10,900 16 AP-200088 摩オ・電子制御ナハテリアル網像物性測定装置 日本電子 JEM-MARITON NEDAMM 35,200 6,700 15,600 11,100 20,000 15,500 24 AP-200086 ガラスインブリント装置 東芝機械 GMP-415V 35,200 2,600 5,900 7,000 10,300 11,400 14 AP-200087 顕微紫外 可視分光装置 日本分光 MSV-5200 8,800 2,700 4,100 7,100 8,500 11,500 12 AP-200088 微器網形状測定機 小坂研究所 ET200 17,600 800 1,100 5,200 5,500 9,600 5 AP-200089 マニエアルスパッタ 自作 - 17,600 900 1,400 5,300 5,800 9,700 10	AP-200065	超高真空AFM		JAFM-4500XT	211,200						10,800
AP-200079 情密イオンミリングシステム 日本ガタン PIPSII model 695 35,200 1,700 1,800 6,100 6,200 10,500 10 AP-200080 レーザー措画装置 ハイデルベルグ DWL66+ 35,200 6,400 10,900 10,800 15,300 15,200 15 AP-200081 集東イオンビーム加工製祭装置 日本電子 JEM-9320FIB 0 2,700 6,200 7,100 10,600 11,500 13 AP-200082 次族光電子分光装置 日本電子 JPS-9200 30,800 2,100 6,800 6,500 11,200 10,900 13 AP-200083 プラズマズ原子層堆積装置 サムコ AD-230LP-H 35,200 5,700 13,200 10,100 17,600 14,500 22 AP-200084 卓上型ランガ加熱装置 アドバンス理工 MILA-5000-P-N 35,200 2,100 6,500 6,500 10,900 16 AP-200085 素子電子制即ナアラリアル網熱特性測定装置 日本電子 JBM-MSAIGNOF NEDAMM 35,200 6,700 15,600 11,100 20,000 15,500 24 AP-200086 ガラスインブリント装置 東芝機械 GMP-415V 35,200 2,600 5,900 7,000 10,300 11,400 14 AP-200087 顕微紫外可視分光装置 日本分光 MSV-5200 8,800 2,700 4,100 7,100 8,500 11,500 12 AP-200088 微細形状測定機 小坂研究所 ET200 17,600 800 1,100 5,200 5,500 9,600 5											14,200
AP-200080 レーザー措画装置 ハイデルベルグ DWL66+ 35,200 6,400 10,900 15,300 15,300 15,200 15 AP-200081 集東イオンビーム加工観察装置 日本電子 JEM-9320FIB 0 2,700 6,200 7,100 10,600 11,500 15 AP-200082 X線光電子分光装置 日本電子 JPS-9200 30,800 2,100 6,800 6,500 11,200 10,900 18 AP-200083 ブラズマズ原子層堆積装置 サムコ AD-230LP-H 35,200 5,700 13,200 10,100 17,600 14,500 22 AP-200084 卓上型ランブ加熱装置 アドバンス理工 MILA-5000-P-N 35,200 2,100 6,500 6,500 6,500 10,900 16 AP-200085 景千・東子朝神ナンマデザル編集物性調定装置 日本電子 JEM-MAIGNOF NEOAMM 35,200 6,700 15,600 11,100 20,000 15,500 24 AP-200086 ガラスインブリント装置 東芝機械 GMP-415V 35,200 2,600 5,900 7,000 10,300 11,400 14 AP-200087 顕微紫外可視分光装置 日本分光 MSV-5200 8,800 2,700 4,100 7,100 8,500 11,500 12 AP-200088 微細形状測定機 小坂研究所 ET200 17,600 800 1,100 5,200 5,500 9,600 5											14,600
AP-20008 集束イオンビーム加工製廃装置 日本電子 JEM-9320FiB 0 2,700 6,200 7,100 10,600 11,500 11 1,50											10,600
AP-200082 X終光電子分光装置 日本電子 JPS-9200 30,800 2,100 6,800 6,500 11,200 10,900 15 AP-200083 ブラズマ式原子層堆積装置 サムコ AD-230LP-H 35,200 5,700 13,200 10,100 17,600 14,500 22 AP-200084 卓上型ランプ加熱装置 アドベンス理工 MILA-5000-P-N 35,200 2,100 6,500 6,500 10,900 16 AP-200085 量子・電子制御ナノンデリア小場最熱性測定装置 日本電子 JEM-ANRAGEON NEOARM 35,200 6,600 11,100 20,000 15,500 24 AP-200088 ガラスインプリント装置 東芝機械 GMP-415V 35,200 2,600 5,900 7,000 10,300 11,400 14 AP-200088 養養等等 日本分光 MSV-5200 8,800 2,700 4,100 7,100 8,500 11,500 12 AP-200088 養養等 小坂研究所 巨7200 17,600 800 1,100 5,200 5,500 9,600 5 AP-200089 マニアルスパッタ 自作 - 17,600 900 1,400 5,300 5,800 9,											19,700
AP-200083 ブラズマ太原子層堆積装置 サムコ AD-230LP-H 35,200 5,700 13,200 10,100 17,600 14,500 22 AP-200084 卓上型ランブ加熱装置 アドベンス理工 MILA-5000-P-N 35,200 2,100 2,100 6,500 6,500 10,900 16 AP-200085 岩子・電子柳鮮ナケッサア小原原向性原定装置 日本電子 JEM-ARRADON NEOARM 35,200 6,700 15,600 11,100 20,000 15,500 24 AP-200086 ガラスインプリント装置 東芝機械 GMP-415V 35,200 2,600 5,900 7,000 10,300 11,400 14 AP-200087 顕微紫外可視分光装置 日本分光 MSV-5200 8,800 2,700 4,100 7,100 8,500 11,500 12 AP-200088 微維形状測定機 小坂研究所 巨7200 17,600 800 1,100 5,200 5,500 9,600 5 AP-200089 マニアルスパッタ 自作 - 17,600 900 1,400 5,800 9,700 10											15,000
AP-200084 卓上型ランブ加熱装置 アドバンス理工 MILA-5000-P-N 35,200 2,100 2,100 6,500 6,500 10,900 10 AP-200085 量子・電子制御ナンアウリアル環席物性海定装置 日本電子 JEM-ARALDONF NEDAMM 35,200 6,700 15,600 11,100 20,000 15,500 24 AP-200088 ガラスインプリント装置 東芝機械 GMP-415V 35,200 2,600 5,900 7,000 10,300 11,400 14 AP-200089 顕微紫外可視分光装置 日本分光 MSV-5200 8,800 2,700 4,100 7,100 8,500 11,500 12 AP-200088 微維形状測定機 小坂研究所 ET200 17,600 800 1,100 5,200 5,500 9,600 9 AP-200089 マニュアルズペッタ 自作 - 17,600 900 1,400 5,300 5,800 9,700 16	AP-200082			*							15,600
AP-200085 量子・電子桐桝ナ/マデリアル撮影物性測定装置 日本電子 担当本地区の00F NED AND L 35,200 6,700 15,600 11,100 20,000 15,500 24 AP-200086 ガラスインプリント装置 東芝機械 GMP-415V 35,200 2,600 5,900 7,000 10,300 11,400 14 AP-200087 顕微紫外可視分光装置 日本分光 MSV-5200 8,800 2,700 4,100 7,100 8,500 11,500 12 AP-200088 微維形状測定機 小坂研究所 ET200 17,600 800 1,100 5,200 5,500 9,600 5 AP-200089 マニュアルスパッタ 自作 - 17,600 900 1,400 5,300 5,800 9,700 16	AP-200083	プラズマ式原子層堆積装置	サムコ	AD-230LP-H	35,200	5,700	13,200	10,100	17,600	14,500	22,000
AP-20088 ガラスインプリント装置 東芝機械 GMP-415V 35,200 2,600 5,900 7,000 10,300 11,400 14 AP-20088 黄藤紫外可視分光装置 日本分光 MSV-5200 8,800 2,700 4,100 7,100 8,500 11,500 12 AP-20088 微細形状測定機 小坂研究所 ET200 17,600 800 1,100 5,200 5,500 9,600 9 AP-20089 マニュアルスペッタ 自作 - 17,600 900 1,400 5,300 5,800 9,700 10	AP-200084	卓上型ランブ加熱装置	アドバンス理工	MILA-5000-P-N	35,200	2,100	2,100	6,500	6,500	10,900	10,900
AP-200087 顕微紫外可視分光装置 日本分光 MSV-5200 8,800 2,700 4,100 7,100 8,500 11,500 12 AP-200088 微細形状測定機 小坂研究所 ET200 17,600 800 1,100 5,200 5,500 9,600 5 AP-200089 マニュアルスジッタ 自作 - 17,600 900 1,400 5,300 5,800 9,700 16	AP-200085	量子・電子制御ナノマテリアル顕微物性測定装置	日本電子	JEM-ARM200F NEOARM	35,200	6,700	15,600	11,100	20,000	15,500	24,400
AP-200087 顕微紫外可視分光装置 日本分光 MSV-5200 8,800 2,700 4,100 7,100 8,500 11,500 12 AP-200088 微細形状測定機 小坂研究所 ET200 17,600 800 1,100 5,200 5,500 9,600 5 AP-200089 マニュアルスジッタ 自作 - 17,600 900 1,400 5,300 5,800 9,700 10	AP-200086	ガラスインプリント装置	東芝機械	GMP-415V	35,200	2,600	5,900	7,000	10,300	11,400	14,700
AP-200088 微細形状測定機 小坂研究所 ET200 17,600 800 1,100 5,200 5,500 9,600 5 AP-200089 マニュアルスペッタ 自作 - 17,600 900 1,400 5,300 5,800 9,700 10											12,900
AP-200089 マニュアルスパッタ 自作 - 17,600 900 1,400 5,300 5,800 9,700 10											9,900
AP-200990 フマンイメージング装置											10,200
	AP-200090	ラマンイメージング装置	堀場製作所	HR-Evolution type pa nano	26,400	3,700	5,400	8,100	9,800	12,500	14,200

技術支援料(サンブル前処理・設計等)	技術相談料		
4,400円 / 時間			
(ただし、高度な知識及び経験を必要とされる作業、複数の技術を組み合わせる作業、その他の難易 度の高」、作業を伴う場合にあっては8,800円)	11,000円 / 時間		